

Structural and electronic properties of $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$)

Saba Ahmadvand, Shirin Namjoo*, Mahsa Ganji, Mehrdad Dadsetani

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran

Received: 06.10.2023 Final revised: 11.11.2023 Accepted: 29.01.2024

Doi: [10.22055/jrmbms.2024.18899](https://doi.org/10.22055/jrmbms.2024.18899)

Abstract

In this study, the structural properties and electronic band structure of $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$) alloys are investigated using density functional theory utilizing the WIEN2K package. The results related to the structural properties showed that the lattice constant, as a function of x , is in excellent agreement with Vegard's linear rule. Calculations involving the investigation of the band structure using the mBJGGA exchange-correlation potential reveal that InSb is a semiconductor with a small gap, exhibiting a normal band order at the Γ point while InBi is a metal that exhibits a band inversion at the Γ point. By adding Bi to InSb and forming $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ and $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ alloys, the normal band order and the gap at the Γ point disappear. This leads to a transition from a narrow band gap semiconductor with normal band order (InSb) to a gapless semiconductor ($\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$) and a metal ($\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$) with an inverted band order. By replacing half of the Sb atoms with Bi atoms in InSb and creating the $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ alloy, not only is an inverted band order observed at the Γ point but a band gap is also created and a transition from a conventional semiconductor to a topological semiconductor occurs.

Keywords: Density Functional Theory, Inverted Band Order, Topological Semiconductor, Spin- Orbit Splitting

*Corresponding Author: namjoo_sh@yahoo.com

خواص ساختاری و الکترونی ($\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$))

صبا احمدوند، شیرین نامجو*، مهسا گنجی، مهرداد دادستانی

گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، لرستان، ایران

دریافت: ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ویرایش نهائی: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

Doi: [10.22055/jrmb.2024.18899](https://doi.org/10.22055/jrmb.2024.18899)

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های ساختاری و ساختار نواری ($\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$)) با استفاده از نظریه تابعی چگالی و توسط کد کامپیوتری WIEN2K مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌های مربوط به محاسبه ویژگی‌های ساختاری نشان می‌دهد که ثابت شبکه به صورت تابعی از x ، در سازگاری عالی با قانون خطی و یگارد قرار دارد. محاسبات مربوط به بررسی ساختار نواری با به‌کارگیری پتانسیل تبادل-همبستگی mBJGGA نشان می‌دهد که InSb یک نیم‌رسانا با پهنای گاف کوچک است که ترتیب نواری عادی‌ای را در نقطه Γ نشان می‌دهد در حالی که InBi یک فلز است که دارای وارونگی نواری در نقطه Γ است. با اضافه شدن Bi به InSb و ایجاد آلیاژهای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ ، نظم نواری عادی و گاف نواری در نقطه Γ از بین می‌رود و این منجر به گذار از نیم‌رسانا با پهنای گاف کم و نظم نواری عادی (InSb) به سمت نیم‌رسانای بدون گاف ($\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$) و فلز ($\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$) با ترتیب نواری وارون می‌شود. با جایگزین شدن نیمی از اتم‌های Sb توسط اتم‌های Bi در InSb و ایجاد آلیاژ $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ ، نه تنها در نقطه Γ نظم نواری وارون مشاهده می‌شود، بلکه در این نقطه یک گاف نواری نیز ایجاد می‌شود، بنابراین گذار از نیم‌رسانای معمولی به سمت نیم‌رسانای توپولوژی اتفاق می‌افتد.

کلیدواژگان: نظریه تابعی چگالی، ترتیب نواری وارون، نیم‌رسانای توپولوژی، شکافتگی اسپین-مدار

مقدمه

را به‌طور مؤثر در ناحیه فروسرخ جذب و گسیل کند و بنابراین می‌تواند برای بسیاری از کاربردهای اپتوالکترونیکی از قبیل آشکارسازهای فروسرخ، حسگرها و دیودهای نوری مناسب باشد [۲-۴]. از دیگر ویژگی‌های این ترکیب می‌توان به تحرک پذیری بالای الکترون در آن اشاره کرد. به دلیل این ویژگی منحصربه‌فرد از این ترکیب برای توسعه ترانزیستورهای پرسرعت، تقویت‌کننده‌ها و سایر قطعه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود [۵]. یکی از راه‌های تغییر کارایی و

InSb یکی از پرکاربردترین ترکیب‌های متعلق به گروه ترکیبات III-V است. ترکیب‌های نیم‌رسانای III-V از دو عنصر تشکیل شده‌اند که یکی از آنها متعلق به گروه سوم و دیگری متعلق به گروه پنجم جدول تناوبی است. InSb دارای کوچک‌ترین پهنای گاف نواری ($E_g=0.18 \text{ eV}$) در دمای ۳۰۰ کلوین) در میان ترکیبات III-V است [۱]. این گاف نواری کوچک باعث می‌شود که InSb نور

* نویسنده مسئول: namjoo_sh@yahoo.com



برای کاربرد در زمینه‌های اسپینترونیک و ترانزیستورهای بدون اتلاف نویدبخش هستند. علی‌رغم اهمیت و کاربرد آلیاژهای InSb-Bi در زمینه‌های متعددی از قبیل الکترونیک، اپتوالکترونیک و همچنین عایق‌های توپولوژی، مطالعات صورت گرفته روی این ترکیبات بسیار محدود است. به همین دلیل این مطالعه اختصاص داده شده است به بررسی خواص ساختاری و ساختار نواری InSb، InBi و همچنین آلیاژهای سه‌تایی $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ این مطالعه در ادامه کاری است که نامجو و همکاران به منظور بررسی خواص ساختاری و ساختار نواری آلیاژهای $\text{InSb}_{1-x}\text{As}_x$ آنها انجام داده‌اند [۸].

روش محاسبات

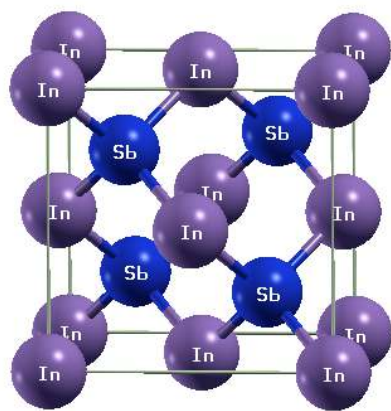
محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی استوار است و از روش امواج تخت به‌ساخته خطی با پتانسیل کامل [۹،۱۰] برای حل معادلات تک‌ذره کوهن-شم استفاده شده است. در این روش با انتخاب کره‌های موفین-تین حول هر یک از اتم‌ها، فضای درون هر یاخته به دو ناحیه تقسیم می‌شود. تابعی چگالی، پتانسیل و توابع موج الکترون‌های ظرفیت در درون کره‌ها برحسب توابع شعاعی و هماهنگ‌های کروی و در خارج از آنها برحسب امواج تختی که بردار موج آنها از تقارن‌های گروه فضایی پیروی می‌کنند، بسط داده می‌شود.

کلیه محاسبات با استفاده از کد کامپیوتری Wien2k [۱۱] انجام گرفته است. پارامتر RK_{\max} (R، شعاع کوچک‌ترین کره موفین-تین و K_{\max} بردار موج تخت برای بسط تابع موج برحسب امواج تخت در ناحیه بین جایگاهی است) برابر ۸ و بردار موج قطع برای بسط پتانسیل و چگالی بار در ناحیه بین جایگاهی $G_{\max}=12$

بهبود عملکرد این ابزارهای الکترونیکی و اپتوالکترونیکی، تشکیل آلیاژهایی از InSb است. این آلیاژها یک بازه از ویژگی‌های غیرقابل انتظار را ارائه می‌دهند و از نظر فناوری خصوصاً در صنایع الکترونیک و الکترواپتیک بسیار مورد توجه هستند. یک دسته از این آلیاژها، آلیاژهایی هستند که با اضافه‌شدن بیسموت به InSb شکل می‌گیرند. بیسموت سنگین‌ترین عنصر غیر رادیواکتیو است. اضافه‌کردن بیسموت به InSb می‌تواند اثرات قابل توجهی روی ساختار نواری، شکافتگی اسپین-مدار و ویژگی‌های اپتیکی آن داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که اضافه‌کردن بیسموت به InSb و در نتیجه ایجاد آلیاژهای InSb-Bi، باعث کاهش قابل توجه گاف نواری و همچنین افزایش شکافتگی اسپین-مدار شود؛ بنابراین این دسته از آلیاژها برای ساخت ابزارهای اپتوالکترونیکی‌ای که در نواحی فرورسرخ میانی و فرورسرخ نزدیک کار می‌کنند، می‌توانند بسیار مناسب باشند. این ترکیبات از منظر توپولوژیکی هم می‌توانند بسیار حائز اهمیت باشند. پیش‌بینی می‌شود که اضافه‌شدن عنصر سنگین بیسموت به InSb سبب گذار به سمت نیم‌رسانای توپولوژی شود. مطابق مطالعات پیشین صورت گرفته [۶،۷]، اضافه‌شدن As به InSb باعث شکل‌گیری فاز توپولوژی می‌شود. با توجه به اینکه بیسموت عنصر سنگین‌تری نسبت به آرسنیک است انتظار مشاهده فاز توپولوژی در آلیاژهای سه‌تایی $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ وجود دارد. جستجو و بررسی مواد توپولوژی و مطالعه ساختار الکترونی آنها به‌عنوان یک موضوع جدید، بسیار جذاب و مدرن در فیزیک ماده چگال ظهور پیدا کرده است. عایق‌های توپولوژی دارای هر دو فاز رسانا و نارسانا به‌طور هم‌زمان در یک ماده هستند. آنها در لایه‌های درونی نارسانا هستند، اما در لایه‌های سطحی رسانندگی قطبیده و محافظت شده‌ای از خود نشان می‌دهند که

موقعیت‌های صفر و اتم‌های Sb موقعیت‌های (۰,۲۵) (۰,۲۵, ۰,۲۵) را اشغال می‌کنند.

پایه آلیاژهای $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ترکیب InSb است. این آلیاژها با قرارگرفتن اتم‌های Bi در موقعیت‌های اتم Sb در ساختار سولفید روی ایجاد می‌شوند. ساختار سولفیدروی InSb در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. ساختار سولفید روی برای ترکیب InSb

باتوجه به وجود چهار جایگاه برای اتم‌های Sb در ساختار سولفید روی InSb، آلیاژهای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ ، $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ به ترتیب با قرارگرفتن یک، دو و سه اتم Bi در جایگاه‌های اتم Sb ایجاد می‌شوند. همان‌گونه که از شکل فوق مشخص است چهار موقعیت اتم‌های Sb معادل هستند و بنابراین در شکل‌گیری $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ ($\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$)، با قرارگرفتن یک اتم Bi (سه اتم Bi) در هر یک از جایگاه‌های اتم Sb (در هر سه جایگاه از چهار جایگاه اتم Sb) تنها یک ساختار متمایز ایجاد می‌شود. ساختار

انتخاب شد. محاسبه‌ها در حضور برهم‌کنش اسپین-مدار انجام شده است. انتگرال فضای فاز برای محاسبه ویژگی‌های ساختاری با استفاده از ۳۰۰۰ نقطه k در منطقه نخست بریلوئن انجام شده است. برای گزینش نقطه‌های k در منطقه نخست بریلوئن از روش تراهدرون خطی استفاده شده است [۱۲]. از آنجا که برای محاسبه ساختار نواری به تعداد نقطه‌های k بیشتری نیاز است، بنابراین ۷۰۰۰ نقطه k به منظور مطالعه ساختار نواری این ترکیب‌ها در نظر گرفته شده است. شعاع کره‌های مافین-تین چنان انتخاب شده‌اند که علاوه بر رعایت شرط عدم همپوشانی کره‌ها، کمترین نشست بار از کره‌های مافین-تین را داشته باشیم. شعاع کره موفین تین برای اتم‌های In, Sb و Bi برابر با $R_{MT} = 2/5 \text{ a.u.}$ در نظر گرفته شده است. برای مطالعه ساختار نواری از پتانسیل تبدیلی همبستگی $m\text{BJGGA}^1$ استفاده شده است [۱۳]. در این مطالعه برای بررسی ویژگی‌های ساختاری تابعی تبدیلی همبستگی GGA (Wu-Cohen) [۱۴] به کار گرفته شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

InSb در ساختار مکعبی مرکز سطحی با گروه فضایی $F\bar{4}3m$ متبلور می‌شود [۱۵]. پایدارترین ساختار برای این ترکیب، ساختار سولفید روی است درحالی‌که پایدارترین ساختار برای InBi ساختار تراگونال PbO است [۱۶]. در این مطالعه به منظور مقایسه خواص الکترونی InBi با InSb، ساختار سولفید روی InBi در نظر گرفته شده است. ساختار سولفید روی یک ساختار FCC است با پایه دو اتمی در موقعیت‌های (۰,۰,۰) و (۰,۲۵, ۰,۲۵, ۰,۲۵). در مورد InSb اتم‌های In

¹modified Beck- Johnson exchange potential together with Local- Density Approximation

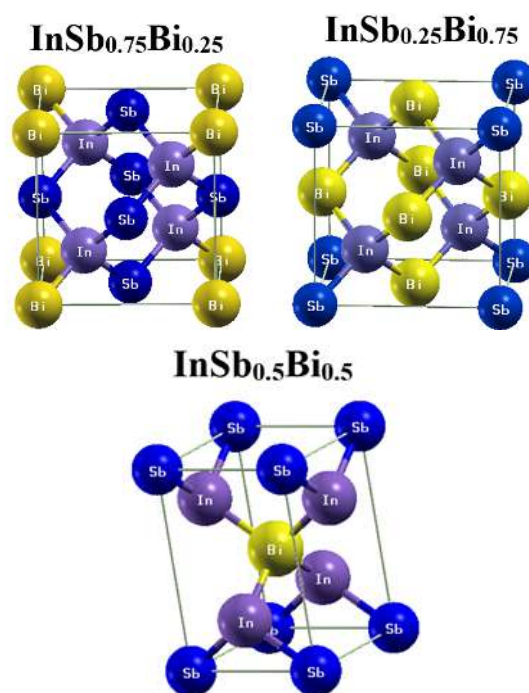
ثابت شبکه برای InSb ، InBi و آلیاژهای سه تایی آنها با بهینه سازی انرژی برحسب حجم محاسبه شده و نتایج به همراه دیگر نتایج نظری و همچنین نتایج تجربی موجود در جدول ۱ آورده شده است. همان طور که در این جدول نشان داده شده است برای ترکیب های دوتایی پارامتر شبکه در سازگاری خوبی با نتایج تجربی قرار دارد. پارامترهای شبکه برای InSb و InBi به ترتیب به اندازه ۰/۸ درصد و ۲/۲ درصد با مقادیرهای تجربی فاصله دارند. علت تفاوت در نتایج به دست آمده و دیگر مطالعه های نظری می تواند به دلیل استفاده از پتانسیل های تبدلی همبستگی مختلف و یا روش های محاسباتی مختلف باشد.

جدول ۱. ثابت شبکه تعادلی ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$)

$\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ و مقایسه با نتایج تجربی و نظری موجود.

ثابت شبکه (انگستروم)			
غلظت آلیاژ	مطالعه حاضر	کارهای تجربی	مطالعه های نظری دیگر
۰	۶۵۳۳	۶۴۷۹ [۱۵]	۶۳۴ [۱۸]، ۶۳۴۶ [۱۹]، ۶۶۳ [۲۰]
۰/۲۵	۶۵۸۸		۶۶۸ [۲۰]
۰/۵	۶۶۵۲		۶۷۱ [۲۰]
۰/۷۵	۶۷۰	-----	۶۸۴ [۲۰]
۱	۶۷۸	۶۶۲۶ [۱۷]	۶۹۱ [۲۰]، ۶۷۱۲ [۲۱]، ۶۸۶ [۲۲]

نتایج حاصل از محاسبه پارامتر شبکه آلیاژها در توافق خوبی با تنها مطالعه نظری که با استفاده از پتانسیل تبدلی همبستگی GGA(PBE) [۲۳] به بررسی خواص ساختاری پرداخته است، قرار دارد [۲۰]. برای این آلیاژها هیچ گونه نتیجه تجربی برای مقایسه وجود



شکل ۲. نمایش ساختار آلیاژهای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ ، $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$

آلیاژهای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ که یک ساختار مکعبی هشت اتمی است در شکل ۲ نشان داده شده است. همچنین در شکل گیری آلیاژ $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ با توجه به معادل بودن موقعیت های اتم Sb ، با قرار گرفتن دو اتم Bi در هر دو موقعیت از چهار موقعیت اتم Sb تنها یک ساختار متفاوت ایجاد می شود. این ساختار که یک ساختار چهار گوشه با ۴ اتم است در شکل ۲ نشان داده شده است.

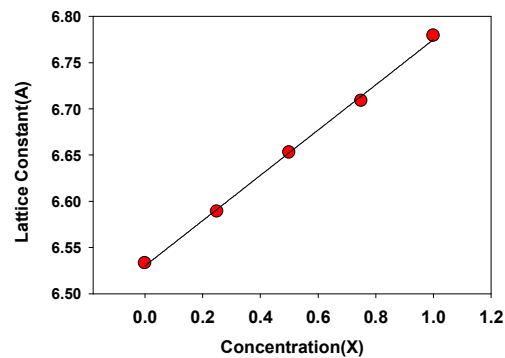
در ادامه پایداری ترمودینامیکی آلیاژهای InSb_{1-x}Bi_x با محاسبه انرژی تشکیل که به صورت:

$$E_f = E(\text{alloy}) - x E(\text{InBi}) - (1-x) E(\text{InSb}) \quad ۱$$

تعریف می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه فوق $E(\text{alloy})$ ، $E(\text{InBi})$ و $E(\text{InSb})$ به ترتیب کمینه انرژی کل $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ، InBi و InSb است. مقدار انرژی تشکیل محاسبه شده برای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ ، $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ به ترتیب ۰.۱۳ eV/atom، ۰.۰۲ eV/atom و ۰.۱۷ eV/atom است. مقادیر بسیار کوچک مثبت انرژی تشکیل می‌تواند نشان‌دهنده امکان‌پذیری این سیستم‌های شبه‌پایدار از طریق فرایند سنتز گرماگیر مناسب باشد. مقدار انرژی تشکیل محاسبه شده برای $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ بیشتر از مقادیر محاسبه شده انرژی تشکیل برای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ است که این امر نشان‌دهنده شبه‌پایداری کمتر $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ نسبت به $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ است.

بر پایه ثابت‌های شبکه تعادلی به دست آمده از مرحله قبل در ادامه به محاسبه ساختار نواری InSb ، InBi و $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ (0.25, 0.5, 0.75) پرداخته می‌شود. نوارهای انرژی برای ترکیبات III-V با ساختار سولفید روی، در مرکز ناحیه نخست بریلوئن دارای تقارن گروه نقطه‌ای Γ_8 (نوار تبهگن چهارگانه آبی‌رنگ)، Γ_7 (نوار ظرفیت مشکی رنگ با تبهگنی دوگانه) و Γ_6 (نوار قرمز رنگ با تبهگنی دوگانه) هستند [۲۵]. شکافتگی اسپین-مدار به صورت تفاوت انرژی بین حالت‌های Γ_8 و Γ_7 به صورت:

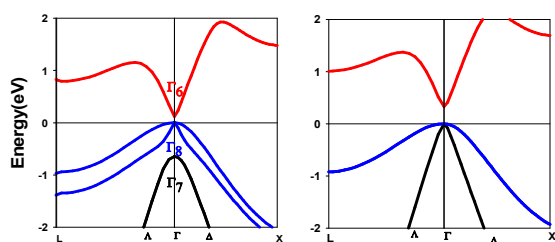
ندارد. در تشابه با ترکیب‌های دوتایی InSb و InBi پیش‌بینی می‌شود که مقادیر محاسبه شده پارامترهای شبکه برای آلیاژها در سازگاری خوبی با نتایج تجربی باشد. هنگامی که نقطه‌های مشخص‌کننده ثابت شبکه به‌ازای غلظت‌های مختلف با معادله مرتبه نخست $a = ۰.۲۴x + ۶.۵۳$ برازش داده می‌شود، مشاهده می‌شود میزان انحراف نقطه‌های موردنظر از این معادله‌های خطی بسیار ناچیز است (شکل ۳). این امر نشان می‌دهد که قانون ویگارد [۲۴] می‌تواند تخمینی عالی برای به‌دست آوردن ثابت شبکه آلیاژهای $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ باشد. قانون تجربی ویگارد بیان می‌کند که ویژگی‌های فیزیکی یک آلیاژ با تقریب خوبی می‌تواند با یک رابطه خطی بین ویژگی فیزیکی و غلظت آلیاژ به دست آید.



شکل ۳. ثابت شبکه برحسب غلظت ناخالصی برای InBi ، InSb و آلیاژهای $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ (0.25, 0.5, 0.75). نقاط مشخص‌کننده پارامتر شبکه برحسب غلظت با معادله مرتبه نخست $a = ۰.۲۴x + ۶.۵۳$ برازش داده شده‌اند.

همان‌گونه که شکل فوق نشان می‌دهد پارامتر شبکه با افزایش غلظت ناخالصی Bi افزایش می‌یابد. علت این امر به بزرگ بودن شعاع اتمی Bi در مقایسه با Sb مرتبط است.

InSb با و بدون در نظر گرفتن برهم‌کنش اسپین-مدار و با به‌کارگیری تقریب mBJGGA در شکل ۵ نشان داده شده است. شکل ۵ ساختار نواری InSb را با به‌کارگیری پتانسیل تبدیلی-همبستگی mBJGGA نشان می‌دهد. همان‌گونه که از این ساختار نواری مشخص است، InSb یک نیم‌رسانا با گاف نواری مستقیم ۰٫۱۲ الکترون-ولتی در مرکز ناحیه نخست بریلوئن است. مقدار گاف نواری محاسبه شده با به‌کارگیری این تقریب در سازگاری بسیار خوبی با مقدار تجربی ۰٫۱۸ الکترون‌ولت قرار دارد [۱].



شکل ۵. ساختار نواری InSb در حضور برهم‌کنش اسپین مدار (چپ) و بدون در نظر گرفتن اسپین-مدار (راست) با به‌کارگیری تابعی تبدیلی همبستگی mBJGGA

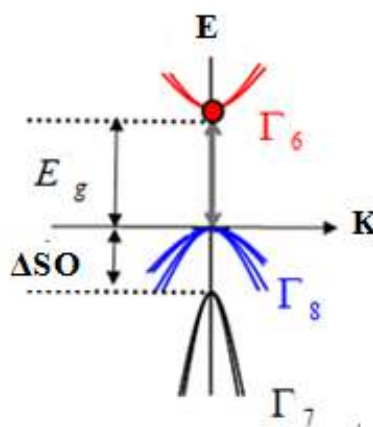
مقدار گاف نواری محاسبه شده در مطالعه حاضر با به‌کارگیری پتانسیل تبدیلی-همبستگی mBJGGA در مقایسه با کارهای نظری دیگر که از پتانسیل‌های GGA و LDA برای محاسبه گاف نواری استفاده کرده‌اند، به سازگاری بیشتری با نتایج تجربی منجر می‌شود. به‌عنوان مثال نتیجه به‌دست‌آمده از محاسبات حاضر بهبود قابل توجهی را نسبت به نتیجه‌های به‌دست‌آمده از محاسبات هاجلافی^۱ و همکاران [۲۷] که گاف این

$$\Delta SO = E(\Gamma_8) - E(\Gamma_7) \quad ۲$$

است. همچنین گاف نواری به‌صورت:

$$E_g = E(\Gamma_6) - E(\Gamma_8) \quad ۳$$

است. ترتیب نواری‌ای که در اکثر ترکیب‌های III-V با ساختار سولفید روی (از انرژی بالا به سمت انرژی پایین) مشاهده می‌شود به‌صورت Γ_6 ، Γ_8 ، Γ_7 است. چنین ترتیب نواری‌ای ترتیب نواری عادی نامیده می‌شود. این ترتیب نواری عادی، گاف نواری و شکافتگی اسپین-مدار به‌طور شماتیک در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴. ساختار نواری ترکیب‌های نیم‌رسانای III-V به‌صورت شماتیک [۲۶].

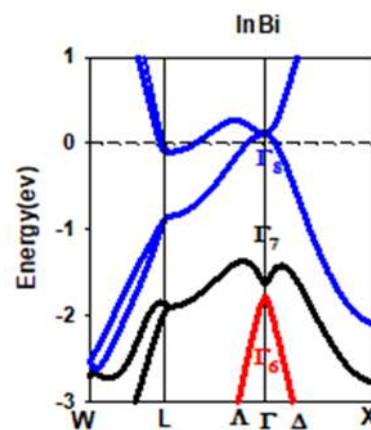
چنانچه برهم‌کنش اسپین-مدار در نظر گرفته نشود، در این صورت قله نوار ظرفیت در مرکز ناحیه اول بریلوئن برای ترکیب‌های III-V به‌علت تبهگنی اوربیتال‌های اتمی، تبهگن شش‌تایی است. در این حالت دارای سه نوار ظرفیت هستیم که به‌علت اسپین هریک تبهگن دوگانه هستند. برای درک بهتر این مطلب ساختار نواری

^۱ Hachelafi

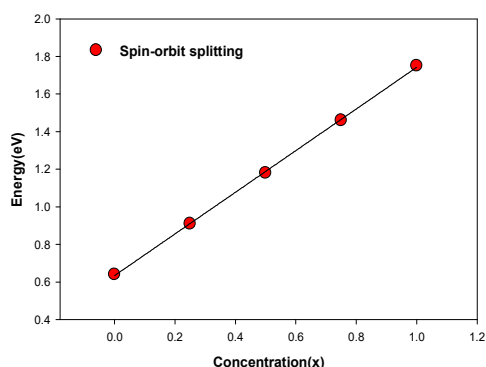
همان‌گونه که از این شکل مشخص است InBi یک فلز با ترتیب نواری وارون است. وجود وارونگی نواری در ساختار نواری می‌تواند نشانه‌ای از برهم‌کنش قوی اسپین-مدار باشد. با محاسبه شکافتگی اسپین-مدار در این ترکیب می‌توان به قوی بودن برهم‌کنش اسپین-مدار پی‌برد. در مطالعه حاضر مقدار شکافتگی اسپین مدار ۱٫۸۸ الکترون-ولت به دست آمده است که در مقایسه با مقدار مشابه در InSb (۰٫۶۴ الکترون-ولت) بسیار بزرگ و قابل توجه است، بنابراین بزرگ بودن برهم‌کنش اسپین-مدار در InBi سبب بروز وارونگی نواری در ساختار نواری این ترکیب می‌شود که این ترتیب نواری وارون در مرکز ناحیه اول بریلوئن می‌تواند نشانه‌ای محکم بر وجود فاز توپولوژیکی باشد، بنابراین، با توجه به وارونگی نواری‌ای که به علت وجود عنصر سنگین بیسموت در ساختار نواری InBi مشاهده شد، انتظار می‌رود اضافه کردن این عنصر به InSb بتواند اثرات قابل توجهی روی ساختار نواری و ترتیب نواری این ترکیب ایجاد کند. به همین منظور در ادامه به بررسی ساختار نواری $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ ، $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ که به ترتیب با جایگزین شدن ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ اتم‌های Sb توسط اتم‌های Bi در ساختار سولفید روی InSb ایجاد می‌شود، می‌پردازیم. اضافه شدن بیسموت به InSb، تغییرات قابل توجهی روی ساختار نواری و شکافتگی اسپین-مدار ایجاد می‌کند. با توجه به سنگین بودن عنصر بیسموت، اضافه شدن بیسموت به InSb سبب افزایش برهم‌کنش اسپین مدار و ایجاد وارونگی نواری در

ترکیب را صفر محاسبه کرده است، نشان می‌دهد. علت اختلاف زیاد نتیجه‌های ناشی از محاسبات هاجلافی با مقدار تجربی و نتایج محاسبات حاضر، استفاده از تابعی تبدلی همبستگی GGA(PBE) در محاسبه گاف نواری است.

همان‌طور که اشاره شد شکافتگی اسپین-مدار به صورت تفاوت انرژی بین حالت‌های Γ_7 و Γ_8 است. در مطالعه حاضر این کمیت ۰٫۶۴ الکترون-ولت به دست آمده است که این مقدار در توافق خوبی با مقدار تجربی ۰٫۸۱ الکترون-ولت [۱] قرار دارد. با توجه به پیش‌بینی دقیق‌تر گاف نواری با استفاده از پتانسیل تبدلی همبستگی mBJGGA، ادامه محاسبات با استفاده از همین تابعی انجام گرفته است. شکل ۶ ساختار نواری InBi را که با در نظر گرفتن برهم‌کنش اسپین-مدار و با استفاده از تقریب mBJGGA مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد.



شکل ۶. ساختار نواری InBi با به‌کارگیری پتانسیل تبدلی همبستگی mBJGGA.



شکل ۷. شکافتگی اسپین-مدار برحسب غلظت ناخالصی برای InSb، InBi، و آلیاژهای $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ (0.25, 0.5, 0.75). نقاط مشخص‌کننده شکافتگی اسپین-مدار با معادله $\Delta\text{SO}=0.63+1.1x$ برازش داده شده است.

ساختار نواری $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ ، $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ و همچنین $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ به ترتیب در شکل‌های ۸ و ۹ نشان داده شده است. مطابق شکل ۷، $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ یک نیم‌رسانای بدون گاف با ترتیب نواری وارون در نقطه Γ است در حالی که $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ فلزی است که دارای ترتیب نواری وارون در مرکز ناحیه اول بریلوئن است. از آنجا که $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ دارای تقارن مکعبی هستند؛ بنابراین مشخصه نوارهای انرژی آنها در اطراف نقطه Γ مشابه مشخصه این نوارها در InBi است و در این آلیاژها نیز بدون اینکه در نقطه Γ گاف نواری ایجاد شود Γ_6 پایین تر از Γ_8 قرار می‌گیرد. این امر به خوبی در شکل ۸ نشان داده شده است.

ساختار نواری می‌شود. همان‌گونه که در جدول ۲ آورده شده است یکی از اثرات افزایش غلظت Bi، افزایش شکافتگی اسپین-مدار است. علت این امر می‌تواند با توجه به این حقیقت که شکافتگی اسپین-مدار با افزایش عدد اتمی افزایش می‌یابد، توجیه شود. از آنجا که Bi در مقایسه با Sb دارای عدد اتمی بزرگ‌تری است؛ بنابراین با افزایش غلظت Bi شکافتگی اسپین-مدار افزایش می‌یابد. مقادیر شکافتگی اسپین-مدار در جدول ۲ آورده شده است.

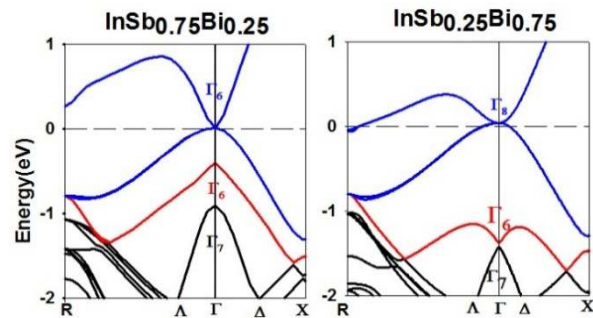
جدول ۲. شکافتگی اسپین-مدار $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$)

ترکیب	شکافتگی اسپین-مدار (الکترون-ولت)
InSb	۰٫۶۴
$\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$	۰٫۹۱
$\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$	۱٫۱۸
$\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$	۱٫۴۶
InBi	۱٫۷۸

مشخص‌کننده شکافتگی اسپین-مدار با معادله $\Delta\text{SO}=1.1x + 0.63$ برازش داده شده‌اند. همان‌گونه که شکل ۷ نشان می‌دهد، میزان انحراف شکافتگی اسپین-مدار از این معادله خطی بسیار ناچیز است و این امر نشان می‌دهد که نتیجه‌های به دست آمده از محاسبه شکافتگی اسپین-مدار برحسب غلظت ناخالصی به خوبی از قانون ویگارد پیروی می‌کنند.

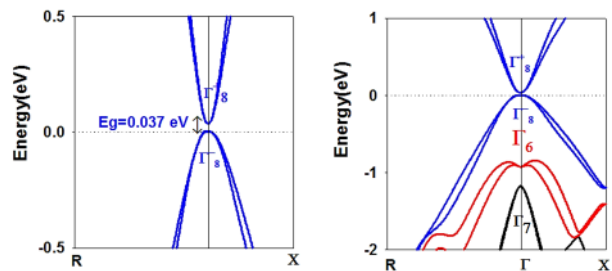
بحث و نتیجه‌گیری

با استفاده از روش امواج تخت به‌ساخته خطی با پتانسیل کامل، در چارچوب نظریه تابعی چگالی، ویژگی‌های ساختاری و ساختار نواری InBi ، InSb و آلیاژهای سه‌تایی $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0.25, 0.5, 0.75$) مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای شبکه ترکیب‌های InBi ، InSb و آلیاژهای سه‌تایی $\text{InSb}_{1-x}\text{Bi}_x$ ($x=0.25, 0.5, 0.75$) با به‌کارگیری تابعی تبدیلی همبستگی $\text{GGA}(\text{Wu-Cohen})$ محاسبه شده‌اند. نتیجه‌های به‌دست‌آمده در سازگاری خوبی با نتیجه‌های تجربی و نظری موجود قرار دارند. برای محاسبه ساختار نواری، پتانسیل تبدیلی همبستگی mBJGGA به‌کار گرفته شده است. همچنین برای انجام این محاسبات برهم‌کنش اسپین-مدار نیز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از محاسبات نشان می‌دهد که InSb نیم‌رسانایی با گاف نواری کوچک 0.12 الکترون-ولت و ترتیب نواری عادی است در حالی که InBi در فاز فلزی قرار دارد و دارای وارونگی نواری در نقطه Γ است. در مطالعه حاضر مقدار شکافتگی اسپین مدار برای InBi ، 1.88 الکترون-ولت به‌دست‌آمده است که در مقایسه با مقدار مشابه در InSb که در مطالعه حاضر مقدار آن 0.64 الکترون-ولت محاسبه شده است، بسیار بزرگ و قابل توجه است. با توجه به سنگین بودن عنصر بیسموت، اضافه‌شدن آن به InSb سبب افزایش قابل توجه قدرت شکافتگی اسپین مدار می‌شود. میزان شکافتگی اسپین مدار از 0.64 الکترون-ولت در InSb به 0.91 الکترون-ولت در $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ ، 1.18 الکترون-ولت در $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و 1.46 الکترون-ولت در $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ می‌رسد. همچنین با اضافه‌شدن Bi به InSb و ایجاد آلیاژهای $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ ضمن حفظ شدن تقارن مکعبی گذار از نیم‌رسانای با پهنای گاف کم و



شکل ۸. ساختار نواری $\text{InSb}_{0.75}\text{Bi}_{0.25}$ و $\text{InSb}_{0.25}\text{Bi}_{0.75}$ در حضور برهم‌کنش اسپین مدار با به‌کارگیری تابعی تبدیلی همبستگی mBJGGA

به‌دلیل وجود تقارن چهارگوشی در $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ ، تبه‌گنی چهارگانه Γ_8 در نقطه گاما از بین می‌رود و یک گاف نواری کوچک به‌اندازه 0.37 الکترون‌ولت بین Γ_8^+ انرژی بالاتر و Γ_8^- انرژی پائین‌تر در نقطه Γ به‌وجود می‌آید. این امر به‌خوبی در شکل ۹ نشان‌داده شده است.



شکل ۹. ساختار نواری $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ در حضور برهم‌کنش اسپین مدار با به‌کارگیری تابعی تبدیلی همبستگی mBJGGA (راست). به‌منظور نشان‌دادن گاف نواری در نقطه Γ ، ساختار نواری $\text{InSb}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}$ در بازه انرژی کوچک‌تر نشان‌داده شده است (چپ).

[4] S.-H. Park, H.-S. Kim, H.-S. Shin, H.-D. Kim, Y.-H. Cho, Y.-K. Kim, Development of InSb semiconductor detector for high resolution radiation measurement, Journal of the Korean Physical Society, 58 (2011) 1577-1580.

<https://doi.org/10.3938/jkps.58.1577>

[5] T. Ashley, M.T. Emeny, D.G. Hayes, K.P. Hilton, R. Jefferies, J.O. Maclean, S.J. Smith, A.W.H. Tang, D.J. Wallis, P.J. Webber, High-performance InSb based quantum well field effect transistors for low-power dissipation applications, 2009 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2009, pp. 1-4.

<http://doi.org/10.1109/IEDM.2009.5424207>

[6] S. Namjoo, A.S.H. Rozatian, I. Jabbari, Influence of lattice expansion on the topological band order of InAs_xSb_{1-x} (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) alloys, Journal of Alloys and Compounds, 628 (2015) 458-463.

<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.12.131>

[7] Z. Zhu, G.W. Winkler, Q. Wu, J. Li, A.A. Soluyanov, Triple Point Topological Metals, Physical Review X, 6 (2016) 031003.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevX.6.031003>

[8] S. Namjoo, A.S.H. Rozatian, I. Jabbari, P. Puschnig, Optical study of narrow band gap InAs_xSb_{1-x} (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) alloys, Physical Review B, 91 (2015) 205205.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.205205>

[9] D.J. Singh, L. Nordstrom, Planewaves, Pseudopotentials, and the LAPW method, Springer Science & Business Media (2006).

[10] S. Blügel, G. Bihlmayer, Full-potential linearized augmented planewave method,

نظم نواری عادی به ترتیب به سمت فلز با نظم نواری وارون و نیم رسانای بدون گاف با نظم نواری وارون رخ می دهد که اگر بتوان به طریقی با شکستن تقارن مکعبی در ساختار نواری آن ها گاف نواری ایجاد کرد، می توان در آن ها گذار فاز توپولوژیکی را مشاهده کرد. در InSb_{0.5}Bi_{0.5} به دلیل شکسته شدن تقارن مکعبی ضمن ایجاد وارونگی نواری در ساختار نواری، یک گاف نواری ۰/۰۳۷ الکترون ولتی در نقطه Γ ایجاد می شود. از آنجاکه وجود وارونگی نواری در نقاط با تقارن بالا نشانه ای قوی از وجود فاز توپولوژی در یک ترکیب است؛ بنابراین با جایگزین شدن نیمی از اتم های Sb در InSb توسط اتم های Bi و ایجاد آلیاژ InSb_{0.5}Bi_{0.5} گذار از نیم رسانای با پهنای گاف کم و نظم نواری عادی به سمت نیم رسانای توپولوژی رخ می دهد. از آنجاکه عایق ها و نیم رساناهای توپولوژی به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارند می توانند در صنعت بسیار حائز اهمیت باشند بنابراین، می توان به اهمیت گذار به سمت این ترکیب ها پی برد.

مرجع ها

[1]. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley (1996).

[2]. N. Kuze, E.G. Camargo, K. Ueno, T. Morishita, M. Sato, M. Kurihara, H. Endo, K. Ishibashi, High performance miniaturized InSb photovoltaic infrared sensors operating at room temperature, Journal of Crystal Growth, 301-302 (2007) 997-1000.

<https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.179>

[3]. P. Carrington, E. Repiso, Q. Lu, H. Fujita, A.R.J. Marshall, Q. Zhuang, A. Krier, InSb-based quantum dot nanostructures for mid-infrared photonic devices, SPIE 9919 (2016) 99190C.

<https://doi.org/10.1117/12.2236869>

<https://doi.org/10.1063/1.4902442>

[18] S. Kalvoda, B. Paulus, P. Fulde, H. Stoll, Influence of electron correlations on ground-state properties of III-V semiconductors, *Physical Review B*, 55 (1997) 4027-4030.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.55.4027>

[19] S.Q. Wang, H.Q. Ye, A plane-wave pseudopotential study on III-V zinc-blende and wurtzite semiconductors under pressure, *Journal of Physics: Condensed Matter*, 14 (2002) 9579. <https://doi.org/10.1088/0953-8984/14/41/313>

[20] P. Saeidi, M.H. Shahidi kaviyani, S. Yalameha, The structural and elastic properties of InSb_{1-x}Bi_x alloys, *Computational Condensed Matter*, 18 (2019) e00358.

<https://doi.org/10.1016/j.cocom.2018.e00358>

[21] A. Assali, M. Bouslama, L. Chaabane, A. Mokadem, F. Saidi, Structural and optoelectronic properties of InP_{1-x}Bi_x bismide alloys for MID-infrared optical devices: A DFT + TB-mBJ study, *Physica B: Condensed Matter*, 526 (2017) 71-79.

<https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.09.058>

[22] A. Zaoui, D. Madouri, M. Ferhat, First-principles study of the ground state stability of III-V bismuth compounds, *Philosophical Magazine Letters*, 89 (2009) 807-813.

<https://doi.org/10.1080/09500830903304125>

[23] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized Gradient Approximation Made Simple, *Physical Review Letters*, 77 (1996) 3865-3868.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865>

Computational nanoscience: do it yourself, 31 (2006) 85-129.

[11] P. Blaha, K. Schwarz, G.K. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, wien2k, An augmented plane wave+ local orbitals program for calculating crystal properties, 60 (2001).

[12] P.E. Blöchl, O. Jepsen, O.K. Andersen, Improved tetrahedron method for Brillouin-zone integrations, *Physical Review B*, 49 (1994) 16223-16233.

<http://doi.org/10.1103/PhysRevB.49.16223>

[13] F. Tran, P. Blaha, Accurate Band Gaps of Semiconductors and Insulators with a Semilocal Exchange-Correlation Potential, *Physical Review Letters*, 102 (2009) 226401.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.226401>

[14] Z. Wu, R.E. Cohen, More accurate generalized gradient approximation for solids, *Physical Review B*, 73 (2006) 235116.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.235116>

[15] O. Madelung, *Semiconductors: data handbook*, Springer Science & Business Media (2004).

[16] M. Ferhat, A. Zaoui, Structural and electronic properties of III-V bismuth compounds, *Physical Review B*, 73 (2006) 115107.

<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.115107>

[17] M.K. Rajpalke, W.M. Linhart, K.M. Yu, M. Birkett, J. Alaria, J.J. Bomphrey, S. Sallis, L.F.J. Piper, T.S. Jones, M.J. Ashwin, T.D. Veal, Bi-induced band gap reduction in epitaxial InSbBi alloys, *Applied Physics Letters*, 105 (2014).

[24] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, Zeitschrift für Physik, 5 (1921) 17-26. <https://doi.org/10.1007/BF01349680>

[25] N. Peyghambarian, S.W. Koch, A. Mysyrowicz, Introduction to semiconductor optics, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA (1993).

[26] W. Feng, D. Xiao, Y. Zhang, Y. Yao, Half-Heusler topological insulators: A first-principles study with the Tran-Blaha modified Becke-Johnson density functional, Physical Review B, 82 (2010) 235121. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.235121>

[27] K. Hachelafi, B. Amrani, F.E.H. Hassan, S. Hiadsi, Theoretical study of InAs, InSb and their alloys InAs_xSb_{1-x}, Advances in Condensed Matter Physics, India (2009).